


文件名稱： 設備作業標準(CF-T13 垂直爐管)
 文件編號： **TSRI-Q3-NL04**
 制訂部門： 蝕刻薄膜組
 制訂日期： 2019-02-15

文件制修訂記錄

版本	編製者	生效日期	核定文號	改版/變更說明	修訂頁次
1.0	巫振榮	2019-02-20	IS108006	制定新版	---
1.1	巫振榮	2025-04-29	IS114012	1. 配合本院企業識別變更為 NIAR，更新文件的企業識別。 2. 修訂文件編號以 10 碼為標準，新增前 4 碼 TSRI。	全

 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心 Taiwan Semiconductor Research Institute		DOCUMENT NO. : TSRI-Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T13 垂直爐管)		
ISSUE DATE	2025-04-29	REVISION	1.1	PAGE	第 1 / 6 頁

一、目的：

定義垂直爐管操作規範，以確保操作品質。

二、範圍：

適用於垂直爐管。

三、權責：


1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過垂直爐管考核通過之人員。

四、名詞定義：

無。

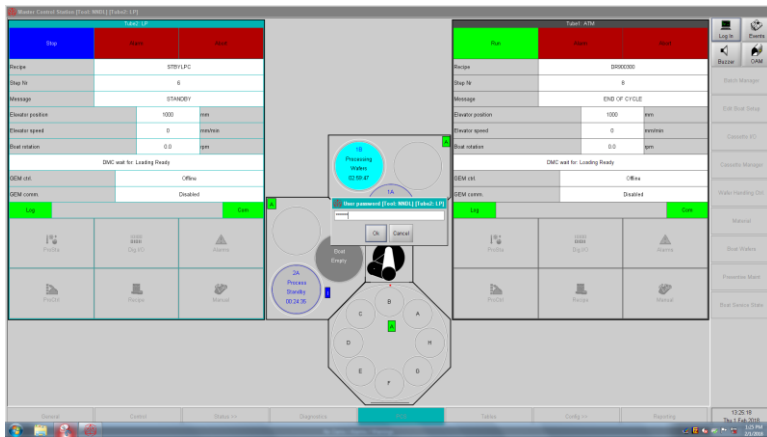
五、相關文件：

垂直爐管 MANUAL。

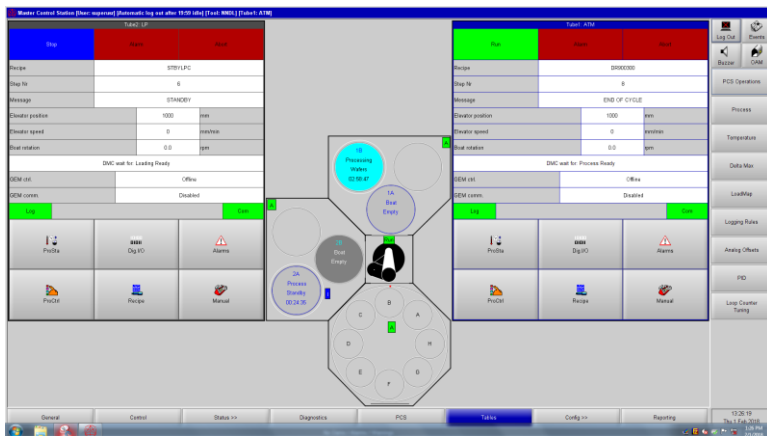
 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心 Taiwan Semiconductor Research Institute		DOCUMENT NO. : TSRI-Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T13 垂直爐管)		
ISSUE DATE	2025-04-29	REVISION	1.1	PAGE	第 2 / 6 頁


六、標準作業程序：

1. 登入 MES 電腦系統。
操作垂直爐管之前，必須登入 MES。
2. 機台登入：
 - (1)從右上角功能選擇單，選擇[login]。
 - (2)在密碼區輸入密碼，選擇[OK]按鈕。



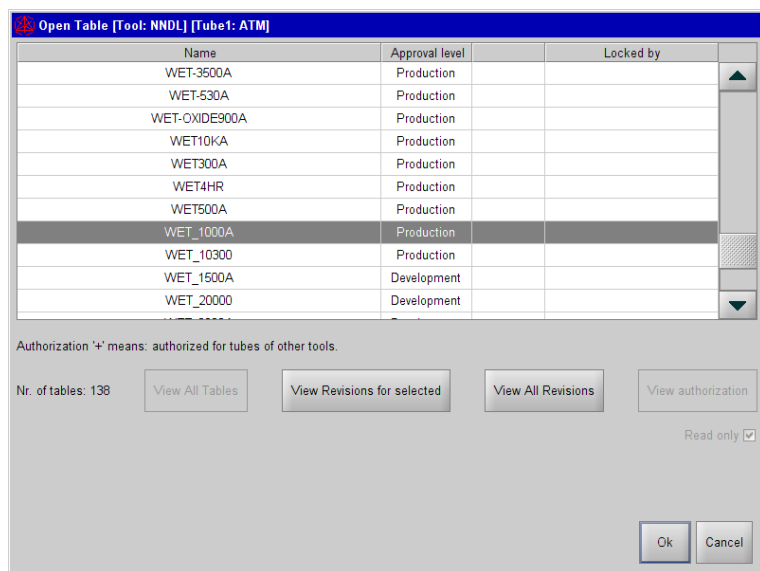
3. 批次執行
步驟 1：點選螢幕下方之[Table]按鈕及右側之[PCS Operations]按鈕



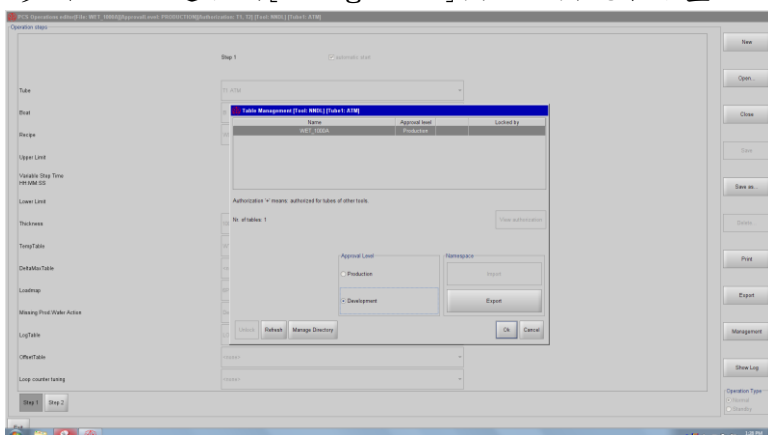
 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心 Taiwan Semiconductor Research Institute		DOCUMENT NO. : TSRI-Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T13 垂直爐管)		
ISSUE DATE	2025-04-29	REVISION	1.1	PAGE	第 3 / 6 頁




步驟 2：點選右方之[Open]按鈕，出現下方畫面。在此畫面選擇 Recipe Name。

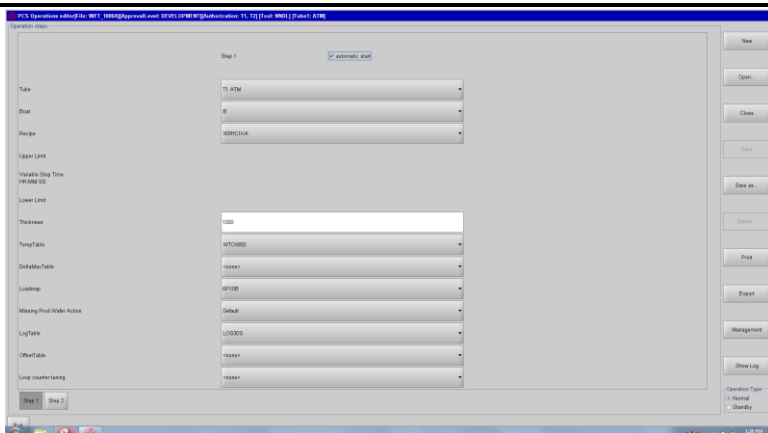


步驟 3：點選右側[Management]按鈕，出現下方畫面，並選擇 Development。

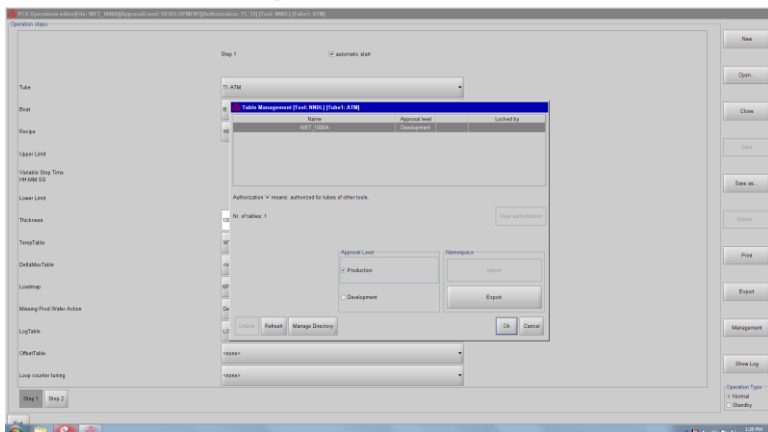


步驟 4：設定 Recipe 內容並選擇右側[Save]按鈕。

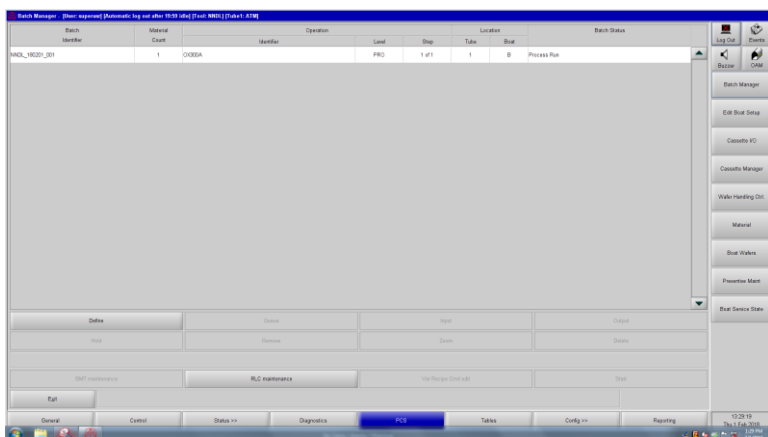
 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心 Taiwan Semiconductor Research Institute		DOCUMENT NO. : TSRI-Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T13 垂直爐管)		
ISSUE DATE	2025-04-29	REVISION	1.1	PAGE	第 4 / 6 頁




步驟 5：點選[Management]及[Production]按鈕，並選擇 OK。

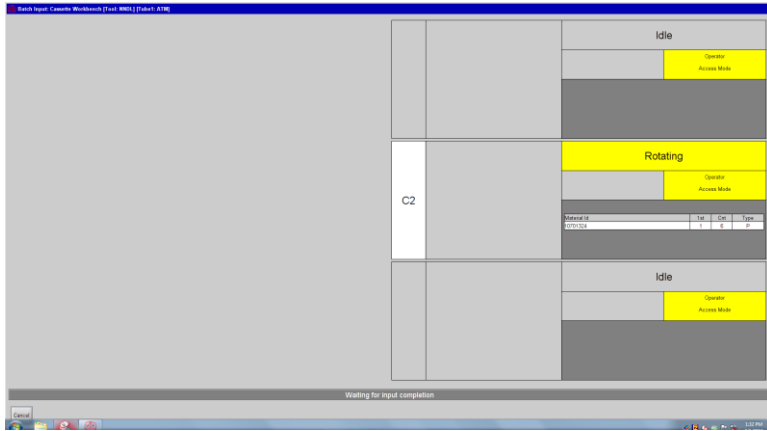


步驟 6：選擇下方之[PCS]按鈕及右側之[Batch Manager]按鈕。



步驟 7：確認設定條件，按[Define]按鈕。

 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心 Taiwan Semiconductor Research Institute		DOCUMENT NO. : TSRI-Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (CF-T13 垂直爐管)		
ISSUE DATE	2025-04-29	REVISION	1.1	PAGE	第 6 / 6 頁



4. 登出 MES 電腦系統。

七、 應用表單及附件：

- 7.1 TSRI-Q4-NL02 設備管理卡
- 7.2 TSRI-Q4-NL03 設備考核表
- 7.3 TSRI-Q4-NL04 設備點檢表
- 7.4 TSRI-Q4-NL05 異常及矯正預防處理單